

# RF スパッタ使用記録

使用者 \_\_\_\_\_

使用日	時間 : ~ :
ターゲット	
基板	
成膜時間	min
成膜時真空度	Torr
RF 出力	W
使用ガス	
ガス流量	SCCM
基板温度	

時間 (分)	真空度 (Torr)	基板温度 ( )	ガス流量 (SCCM)

【備考】